单片集成 10 信道多波长光源

张 灿 朱洪亮 梁 松 韩良顺 王 圩

(中国科学院半导体研究所半导体材料重点实验室,北京 100083)

摘要 采用选择区域外延生长技术和对接再生长技术,设计并制作了 10 信道分布反馈激光器阵列与多模干涉耦 合器的单片集成器件。器件中采用了新的技术,集成了钛薄膜热电阻用于波长调谐。集成器件烧结到热沉上后, 在 25 ℃温控条件下测试,激光器阵列的平均信道间隔为 1.29 nm,阈值电流为 22~30 mA;当激光器注入电流为 200 mA,各信道的平均出光功率为 0.5 mW。集成热电阻的调谐效率约为 5 nm/W,通过施加合适的热电流调谐, 该集成器件可以覆盖 34 路信道间隔为 50 GHz 的波长范围。集成器件可单波长选择输出,也可 10 信道同时运作 合波输出。

关键词 集成光学;分布反馈激光器阵列;选择区域外延生长;多模干涉耦合器;光通信 中图分类号 TN256 **文献标识码** A **doi**: 10.3788/CJL201340.1202001

Monolithically Integrated 10-Channel Multi-Wavelength Light Sources

Zhang Can Zhu Hongliang Liang Song Han Liangshun Wang Wei

(Key Laboratory of Semiconductors Materials, Institute of Semiconductors, Chinese Academy of Sciences, Beijing, 100083, China)

Abstract A monolithic integration of ten distributed feedback lasers with a 10×1 multimode-interference optical combiner using the selective area growth technology is proposed and demonstrated. In the device, Titanium film thermal resistance for wavelength tuning are integrated with a novel procedure. The device is mounted on heat sink and tested at 20 °C. The average channel spacing of the device is 1.29 nm. The average output power of lasers is 0.5 mW with a current of 200 mA and threshold currents of $25 \sim 30$ mA. The tuning efficiency of integrated thermal resistance is about 5 nm/W. The integrated device can cover 34 channels on the 50 GHz ITU (international telecommunication union) grid with a suitable heating power, which can operate separately or simultaneously.

Key words integrated optics; distributed feedback laser array; selective area growth; multimode-interference coupler; optical communications

OCIS codes 140.2010; 140.3290; 130.3120; 140.3600; 140.6810

1 引

光通信系统与网络已成为国家信息基础设施中 重要的信息承载平台,其中光子集成(PIC)技术,尤 其大规模光子集成技术是未来实现大容量、低功耗 光网络的一项解决方案,多波长光子集成芯片将成 为高速率数据传输的重要组成部分^[1-3]。目前国际 上已经报道了几种类型的多波长光源,例如多段式 分布布拉格(DBR)激光器^[4],阵列波导光栅激光 器^[5],分布反馈(DFB)激光器阵列^[6-7]和合波耦合 器(MMI)^[8]以及半导体光放大器的集成器件^[9-12]

收稿日期: 2013-07-22; 收到修改稿日期: 2013-08-22

基金项目:国家 863 计划 (2011AA010303, 2012AA012203)、国家自然科学基金(61021003, 61090392)、国家 973 计划 (2011CB301702)

作者简介: 张 灿(1986—),男,博士研究生,主要从事 InP 基光子集成器件方面的研究。

E-mail: zhangcan537@semi.ac.cn

言

导师简介:朱洪亮(1957—),男,博士生导师,研究员,主要从事半导体光电子功能集成材料和光子集成器件、电吸收调制激光器、新型光伏材料和太阳能电池等方面的研究。E-mail: zhuhl@semi.ac. cn

等。其中单片集成的 DFB 激光器阵列由于其一系 列优点而被广泛应用于现代光波分复用系统。

国外开展的对多波长 DFB 激光器阵列与 MMI 耦合器集成器件的研究时间较早,其制作的 DFB 激 光器阵列都是基于最直接的改变布拉格激射波长的 方式,即通过电子束曝光直写技术制作不同周期的 光栅^[13]和脊倾斜或改变脊宽^[14]。前者费用昂贵月 效率较低,不利于大规模生产;后者的制作精度较 差,不利于激射波长的精确控制。通过电子束曝光 技术制作的多波长 DFB 激光器和 MMI 集成器件 的信道间隔一般控制到 200 GHz,信道间隔难以进 一步减小。目前国内研究大规模光子集成多波长光 源的很少,Zhang 等^[6]已经开展相关研究几年,制作 出4路DFB、MMI和半导体光放大器(SOA)的集 成器件。现在采用选区生长技术已经实现信道间隔 为 25、50、100 GHz以及 200 GHz 的 DFB 激光器阵 列,其可以实现例如 25 GHz 信道间隔的精确控制, 目控制精度高于电子束曝光技术。此外还有几种技 术可用以实现多波长激光器阵列,如倾斜或弯曲脊 波导[15],多次曝光技术[16]以及取样光栅[17]等。这 些技术或者因为工艺容差小,难于实现精确控制;或 者因为制作工艺复杂而不利于高集成度、工艺制备 复杂的器件制备。

对于大规模激光器阵列集成器件,单模成品率 是关键;其次是信道间隔的均匀性。因此需要一种 简单且可以精确控制的技术来同时解决这两个问 题。基于此,提出了采用选区生长外延(SAG)技术 来制备多波长 DFB 激光器阵列的方案。选择区域 外延生长是在图形化的衬底上进行材料外延,由于 材料只能在没有掩膜图形区域沉积,从而造成一对 掩膜图形之间的材料生长速度快干大面积无图形部 分,这会导致两个结果:一是量子阱铟含量的增加改 变量子能级,使荧光增益峰值波长红移;二是外延材 料厚度的增加使相应脊波导的有效折射率增加。而 日掩膜图形(掩膜宽度和生长窗口宽度等)的尺寸决 定了材料的生长速率,即可以通过设计制作不同的 掩膜图形获得不同有效折射率的波导,然后只需采 用常规的全息曝光技术制作均匀光栅即可获得不同 的激射波长。由于选区生长外延可以精确控制外延 参数,其工艺精度高于后工艺的技术手段,有利于获 得均匀信道间隔的激光器阵列,而且其并不增加工 艺复杂度,只是在一次外延有源区时在衬底制作图 形化的掩膜即可。

采用选择 SAG 技术和对接再生长(BJR)技术

设计并制作了单片集成 10 信道 DFB 激光器阵列和 MMI 耦合器的集成器件。

2 设计和制作

图1所示为10信道激光器阵列和 MMI 耦合 器集成器件的结构图。器件尺寸为4000 µm× 2750 µm,其中 DFB 激光器的长度为500 µm,相邻 激光器之间的间隔为250 µm,弯曲波导的长度为 2350 µm。MMI 耦合器的宽度为60 µm,长度为 786 µm。为了减少光反射增加耦合效率,在输入/ 输出端引入了宽度渐变的脊波导结构。





Fig. 1 Optical microscope picture of the integrated device

制作该集成器件时共需要 3 次金属有机化学气 相外延(MOVPE),分别为 SAG 技术、对接再生长 技术和盖层、P 接触层的外延。其中 SAG 技术是为 了制作多波长的 DFB 激光器阵列,对接再生长技术 是为了获得无源区的芯层材料。在 SAG 外延过程 中,首先采用等离子体增强化学气相沉积法 (PECVD)生长一层厚度为 200 nm 的二氧化硅,然 后采用光刻技术定义出一组不同掩膜条宽的图形 *M*,其中掩膜生长窗口的宽度固定为 20 µm,掩膜条 宽 W 以 1.74 µm 的间隔从 4.35 µm 增加到 20 µm, 构成图形化的衬底,如图 2 所示。图中 C 表示信 道,t 表示选区生长的有源区厚度。外延的多量子



图 2 各信道 PL 谱增益峰值波长分布 Fig. 2 Distribution of PL wavelength for each channel

阱有源区由 80 nm 厚的下分别限制层、6 对压应变 的量子阱和 80 nm 的上分别限制层构成。其中大面 积区的阱和垒的厚度分别为 5 nm 和 10 nm。在选区 外延过程中,生长温度固定为 640 ℃,反应室压力为 100 mBar(即 10 Pa)。通过微区光荧光(PL)设备来表 征各个选区生长区域的量子阱特性。PL 谱增益峰值 波长从 1516 nm 增加到 1570 nm,总的红移量为 54 nm,平均的红移速率为每信道 5.96 nm。

在完成一次 SAG 外延生长后,采用对接再生长 技术生长无源的芯层材料。首先,同样生长一层厚 度为 200 nm 的二氧化硅层,采用光刻方法定义出 有源和无源区,再采用反应离子刻蚀(RIE)工艺选 择刻蚀掉无源区域的多量子阱有源区。实验中采用 的是 CH₄/H₂ 混合气源的低损伤刻蚀工艺,并采用 溴基腐蚀液腐蚀界面去除损伤层。然后进行二次外 延,生长一层厚度为 300 nm 的体材料($\lambda_{PL} =$ 1.2 μ m),构成无源区芯层材料。清洗后,在激光器 区上波导层表面采用全息二次曝光技术制备均匀光 栅,再进行磷化铟盖层和 P 型接触层外延。DFB 激 光器和无源区的脊波导分别采用湿法腐蚀和干法 RIE 刻蚀相结合的方式获得的。DFB 激光器区为 湿法腐蚀得到的浅脊波导,而 MMI 及 S 波导为采 用 RIE 干法刻蚀获得的深脊波导。最后进行 P 电 极和 N 电极制作,完成整个器件工艺。

3 器件性能分析

器件芯片解理后烧结在铜热沉上,利用 TEC 将 器件控温在 25 ℃并进行性能测试。用单模透镜光 纤耦合进行功率-电流特性以及光谱特性测试。图 3(a)、(b)分别为 DFB 激光器后端和 MMI 前端的 光功率特性。激光器的阈值电流在 20~30 mA 之 间。DFB 激光器出光端的光功率斜率效率约为 0.13 W/A; MMI 端各信道的平均出光功率为 0.5 mW,斜率效率为 0.0031 W/A。两者的斜率效 率差别是由光波导传输过程的功率损失造成的,分 别包括对接生长界面的耦合损耗、弯曲波导的损耗 以及 MMI 耦合器 10 dB 固有损耗。利用前后的功 率差别计算可知,各个信道的总损耗在 15.1~ 18.4 dB之间。

35 dB,表现出良好的单模特性。为了更好地说明信

道间隔的均匀性,计算了各个信道的激射波长分布



图 3 器件的功率-电流曲线。(a) DFB 激光器出光端;(b) MMI 出光端

Fig. 3 L-I characteristics of the device. (a) DFB facets; (b) MMI output port

利用光纤将出光耦合到光谱仪进行光谱测试, 10个信道的典型叠加输出光谱如图 4(a)所示。从 图中可知,所有信道激射光谱的边模抑制比均高于



图 4 (a) 器件叠加输出光谱曲线; (b) 各信道激射波长分布及偏离线性拟合值

Fig. 4 (a) Superimposed output spectra of the integrated device; (b) wavelength deviation from the fitted value of each channel

道平均间隔为 1.29 nm, 各信道激射波长与线性拟 合偏离值之差小于 0.4 nm, 信道间隔均匀。表明采 用选区生长技术制备的激光器阵列, 不仅工艺简单、 器件成品率高, 而且信道间隔十分均匀, 对于制作多 波长光源具有一定的潜在应用价值。

为了实现匹配到国际电信联盟(ITU)波长的精确调谐,为每一个激光器集成钛薄膜热电阻条。该集成热阻条技术并不增加器件制作的复杂度,而是在制作 P 面电极时同时形成的。电阻条长为

400 μm,宽为12 μm,距离脊波导距离为 20 μm,电 阻值约为 800 Ω。经过测试,热电阻条的调谐效率 约为5 nm/W。图 5(a)为热功率调谐下各信道的波 长调谐特性。由于各信道的平均间隔只有 1.29 nm,只需要很小的热功率(约 258 mW)即可覆 盖所有波长范围。图 5(b)为在合适热功率调谐下, 器件能够覆盖 34 信道 50 GHz 间隔的 ITU 波长,具 有很宽的波长连续调谐范围。



图 5 (a) 各信道波长调谐特性;(b) 热调谐覆盖 34 信道 50 GHz 波长范围 Fig. 5 (a) Tunability of lasing wavelength for each channel; (b) 34 channels on the 50 GHz ITU

grid with a suitable heating power

4 结 论

采用选择区域外延生长技术和对接再生长技术,设计并制作了10信道分布反馈激光器阵列与多模干涉耦合器的单片集成器件。采用新的技术,集成了钛薄膜热电阻用于波长调谐,可覆盖34路信道间隔为50GHz的波长范围。集成器件可以单信道输出,也可10信道同时运作合波输出。提出的采用选择区域外延生长技术制作多波长DFB激光器阵列的方法,只需要大面积全息制作均匀光栅,从而显著降低工艺制作复杂度和制作成本,并且可以精确控制外延生长参数,有利于批量制作集成器件。集成器件采用后工艺手段集成了钛薄膜热电阻,制作工艺简单且热功率调谐效率高,可用于大范围波长精确调谐。该光子集成器件可作为多路10Gb/s并行直调发射器应用于波分复用光网络系统。

参考文献

- 1 R Nagarajan, M Kato, J Pleumeekers, et al.. Large-scale photonic integrated circuits for long-haul transmission and switching [J]. Journal of Optical Communications and Networking, 2007, 6(2): 102-111.
- 2 Wang Qin, Xu Hongchun, Hu Guangwen. Planar lightwave circuit opto-electronic integrated devices for passive optical network[J]. Laser & Optoelectronics Progress, 2012, 49(11): 112301.

汪 钦,徐红春,胡广文.用于无源光网络的平面光波回路光电 集成器件[J].激光与光电子学进展,2012,49(11):112301.

- 3 Liu Xi, Xue Yuan, Xu Hongchun, et al.. Optoelectronic integrated CSFP intelligent transceiver in data communication[J]. Laser & Optoelectronics Progress, 2012, 49(11): 110602.
 刘 希,薛 原,徐红春,等. 数据通信用光电集成智能化 CSFP 光模块[J]. 激光与光电子学进展, 2012, 49(11): 110602.
- 4 W Jia, Y Matsui, D Mahgerefteh, *et al.*. Generation and transmission of 10-Gbaud optical 3/4-RZ-DQPSK signals using a chirp-managed DBR laser[J]. J Lightw Technol, 2013, 30(21): 3299-3305.
- 5 Y Suzaki, H Yasaka, H Mawatari, *et al.*. Monolithically integrated eight-channel WDM modulator with narrow channel spacing and high throughput [J]. IEEE J Sel Top in Quant Electron, 2005, 11(1):43-49.
- 6 C Zhang, S Liang, L Ma, et al.. A modified SAG technique for the fabrication of DWDM DFB laser arrays with highly uniform wavelength spacings [J]. Opt Express, 2012, 20 (28): 29620-29625.
- 7 Xie Hongyun, Huo Wenjuan, Jiang Zhiyun, et al.. Wavelength selectable DFB laser based on non-uniform multiple quantum wells[J]. Chinese J Lasers, 2012, 39(10): 1002002.
 谢红云, 霍文娟, 江之韵, 等. 非统一多量子阱波长可选 DFB 激光器[J]. 中国激光, 2012, 39(10): 1002002.
- Pan Yuzhai, Liu Xiaoli, Su Xiaohui, et al.. Tunable large-modearea fiber lasers based on multimode interference effect [J]. Chinese J Lasers, 2013,40(4):0402003.
 潘玉寨,刘晓莉,苏晓慧,等. 基于多模干涉效应的可调谐大模 场光纤激光器[J]. 中国激光, 2013,40(4):0402003.
- 9 K Yashiki, K Sato, T Morimoto, *et al.*. Wavelength-selectable light sources fabricated using advanced microarray-selective epitaxy[J]. IEEE Photon Technol Lett, 2004, 16(7): 1619-1621.

- 10 L Ma, H L Zhu, S Liang, *et al.*. 1. 55-μm InGaAsP/InP laser array monolithically integrated with multimode-interference combiner and SOA using varied width ridge[J]. Chinese Physics B, 2013, 22(5): 054211.
- 11 H L Zhu, L Ma, S Liang, *et al.*. Four distributed feedback laser array integrated with multimode-interference and semiconductor optical amplifier [J]. Chinese Science Bulletin, 2013, 56(3): 573-578.
- 12 L P Hou, M Haji, J Akbar, et al.. CWDM source based on AlGaInAs/InP monolithically integrated DFB laser array[J]. Opt Lett, 2011, 36(21): 4188-4190.
- 13 K Kudo, T Morimoto, K Yashiki, *et al.*. Wavelength-selectable microarray light sources of multiple ranges simultaneously fabricated on single wafer [J]. Electron Lett, 2000, 36(8): 745-747.

- 14 G P Li, T Makino, A Sarangan, *et al.*, 16-wavelength gaincoupled DFB laser array with fine tunability[J]. IEEE Photon Technol Lett, 1996, 8(1): 22-24.
- 15 A M Sarangan, W P Huang, G P Li, *et al.*. Selection of transverse oscillation modes in tilted ridge DFB lasers [J]. J Lightw Technol, 1996, 14(8): 1853-1858.
- 16 C E Zah, F J Favire, B Pathak, et al.. Monolithic integration of multiwavelength compressive-strained multiquantum-well distributed-feedback laser array with star coupler and optical amplifiers[J]. Electron Lett, 1992, 28(25): 2361-2362.
- 17 H L Zhu, X D Xu, H Wang, *et al.*. The fabrication of eightchannel DFB laser array using sampled gratings[J]. IEEE Photon Technol Lett, 2010, 22(4): 353-355.

栏目编辑:张 腾